구형Ni(OH)2제조에 미치는 계면활성제의 영향

김덕성, 박창훈

경애하는 최고령도자 **김정은**동지께서는 다음과 같이 말씀하시였다. 《과학연구부문에서는 에네르기문제해결에 힘을 집중하여야 합니다.》

정보산업이 급속히 발전하면서 전자공업은 보다 기능화, 소형화, 경량화방향으로 나아 가고있으며 에네르기공급원천인 리티움이온축전지, 알카리니켈축전지의 충전밀도와 비표면적을 개선하여 고속충방전특성을 보다 높일것을 요구하고있다.[1, 2]

질산니켈에 싱아산나트리움과 계면활성제 트윈-80(Tween-80)을 첨가하여 나노수산 화니켈을 제조한 다음 마이크로크기의 수산화니켈과 혼합하여 충전밀도와 비표면적을 크게 할수 있다.[3] 또한 알킬페닐폴리에틸렌옥시드-100(TX-100)+암모니아수+에틸알콜혼합용액에 질산니켈을 첨가[4]하거나 1% 테트라메틸암모니움수산화물과 염화니켈로부터 나노수산화니켈을 얻고 마이크로크기의 수산화니켈과 혼합하여 충전밀도와 비표면적을 크게할수도 있다. 그러나 이 방법들은 종전의 공정을 바꾸어야 하는 결함이 있다.

우리는 암모니아첨가에 의한 수산화니켈생산공정을 그대로 리용하면서 β -Ni(OH) $_2$ 제조과정에 비이온계면활성제 트윈-80을 첨가하여 립자크기가 보다 작고 균일한 고밀도구형수산화니켈을 제조하여 전지의 고속충방전특성을 개선하기 위한 연구를 하였다.

실 험 방 법

시약으로는 NiSO₄·6H₂O(분석순), 18% 암모니아수, NaOH(분석순), 트윈-80, 10% BaCl₂을, 기구로는 교반기가 설치된 2L 반응기, 자동액주입장치(《HL-2B》), pH메터(《pHS-25》), 자동온도조절장치, 건조로(《LP 403》), X선회절분석기(《D/max 2550 VB/PC》), 비표면적측정장치(《Nova 1000》), 주사전자현미경(《ST 2700》)을 리용하였다.

합성방법 β $-Ni(OH)_2$ 의 합성장치와 합성공정은 그림 1, 2와 같다.

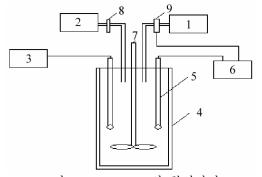


그림 1. β-Ni(OH)₂의 합성장치 1-류산니켈용액, 2-NaOH+NH₃·H₂O+Tween-80혼합 용액, 3-자동온도조절장치, 4-반응기, 5-pH메터, 6-콤퓨터, 7-교반기, 8-류량조절변, 9-자동액주입장치

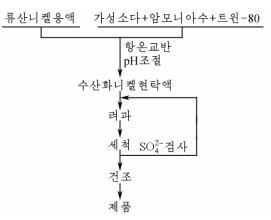


그림 2. β-Ni(OH)₂의 합성공정

부단히 교반하면서 항온이 보장된 2L 반응기에 일정한 농도의 NiSO₄용액과 NaOH+NH₃·H₂O+Tween-80혼합용액을 동시에 적하한다. 반응용액의 pH는 11.5, 교반속도는 250r/min, 반응온도는 52℃, 반응시간은 12h로 보장한다.[1] 반응이 끝나면 10h동안 숙성시킨다. 다음 침전물을 10% BaCl₂에 의하여 SO²₄ 이 검출되지 않을 때까지 증류수로 여러번 려파, 세척하고 건조로(100~110℃)에서 8h동안 건조시킨다. 얻어진 생성물은 록색분말이다.

측정방법 Ni(OH)₂의 충전밀도는 다음과 같은 방법으로 측정한다. 먼저 측정그릇을 에틸알콜로 깨끗이 씻고 건조시킨다. 다음 β-Ni(OH)₂분말을 0.01g의 정확도로 저울질하고 측정그릇안에 넣는다. 분말의 체적이 더는 줄어들지 않을 때까지 진동폭 3~5mm, 회전속도 250r/min으로 12min동안 진동시킨다. 진동이 끝나면 분말의 체적을 측정한다.

충전밀도계산식은 다음과 같다.

$\rho_{AA} = m/V$

여기서 $\rho_{\dot{}_{}^{\dagger}}$ 은 충전밀도(g/cm³), m은 분말의 질량(g), V는 진동후 분말의 체적(cm³)이다. 비표면적은 비표면적측정장치($\langle Nova~1000 \rangle \rangle$)로 측정하였다.

니켈전극만들기 β-Ni(OH)₂: 흑연= 80: 20(질량비)의 비률로 혼합하고 여기에 4% 되게 60% 폴리사불화에틸렌(PTFE)현탁액을 넣은 다음 균일하게 혼합하여 반죽물을 만든다. 이 것으로 쌍통로라에서 두께가 0.08~0.1mm인 막을 만들어 크기가 1.0cm×1.0cm이고 두께가 1.2mm인 발포니켈집전체우에 놓고 10MPa의 압력으로 압착하여 0.15mm정도의 두께를 가진 니켈전극을 만든다. 니켈전극속의 Ni(OH)₂평균함량은 0.03g/cm²이다.

춤방전특성측정 니켈전극의 충방전특성은 3전극계를 리용하여 측정하였다.

니켈전극을 시험전극으로, 금속수소화물(MH)전극을 대극으로, 산화수은전극($\varphi_{Hg/HgO}$ 0.11V)을 비교전극으로 리용하였다. 전해액은 6mol/L KOH용액에 LiOH 15g을 푼 혼합용액이다.

0.1C(28.9mAh/g)로 12~15h동안 충전, 0.1C로 1.0V까지 방전시키고 2차부터는 0.2C로 6~7h동안 충전, 0.2C로 1.0V까지 방전시킨다. 방전비용량이 일정해지면 충방전특성검토실험을 진행한다.

Ni(OH)₂의 구조는 X선회절분석기(《D/max 2550 VB/PC》)로, 분말립자의 형태와 크기는 주사전자현미경(《ST 2700》)으로 분석하였다.

실험결과 및 고찰

반응용액의 pH 11.5, 암모니아수농도 1.6mol/L, Ni²⁺의 농도 1.2mol/L, OH⁻의 농도 2.4mol/L, 교반속도 250r/min, 반응온도 52°C인 조건에서 계면활성제농도에 따르는 립자의 형 태변화는 그림 3과 같다.

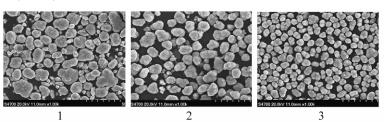


그림 3. 계면활성제농도에 따르는 립자의 형태변화 1-3은 계면활성제농도가 각각 0, 2, 5mL/L인 경우

그림 3에서 보는바와 같이 계면활성제농도에 따라 립자크기의 균일성이 차이난다. 계 면활성제농도가 5mL/L일 때 수사화니켈은 구형 또는 구형에 가까운 형태를 가진다.

공업화된 전극용β-Ni(OH)₂과 계면활성제를 5mL/L 첨가하였을 때와 첨가하지 않았을 때 β-Ni(OH)₂의 기술적지표는 표 1, 2와 같다.

기술적지표

지표	수준
결정구조	eta형
립자형태	구형
충전밀도/(g·cm ⁻³)	1.9~2.1
비표면적/(m²·g ⁻¹)	10~25
비 흥량/(mAh·g ⁻¹)	250~270
립자크기/ <i>μ</i> m	5~30

표 1. 공업화된 전극용 $eta-{
m Ni}({
m OH})_2$ 의 표 2. 계면활성제를 첨가하였을 때와 첨가하지 않았을 때 β -Ni(OH)₂의 기술적지표

7- 10-12-11-11		
-l =	계면활성제를	계면활성제를
지 표 	첨가하지 않았을 때	첨가하였을 때
충전밀도	1.00	2.16
$/(g \cdot cm^{-3})$	1.99	2.16
비표면적	16	26
$/(m^2 \cdot g^{-1})$	10	26
립자크기/ <i>μ</i> m	24	12

표 1, 2에서 보는바와 같이 계면활성제를 첨가하여 제조한 β -Ni(OH),의 립자크기, 충 전밀도, 비표면적값은 전극용β-Ni(OH),의 지표값보다 더 좋다.

산, 알카리수용액에서 비이온계면활성제의 안정성은 음이온 및 양이온계면활성제보다 매우 높으며 비교적 농도가 짙은 산, 알카리용액에서도 강한 계면활성을 나타낸다. 알카리 수용액에서 안정하게 존재하는 비이온계면활성제인 트윈-80의 농도가 5mL/L일 때 제일 좋 은 효과를 나타낸다. 계면활성제농도가 묽으면 β-Ni(OH)₂에 대한 계면활성작용이 약하므 로 립자들은 계속 응집되면서 구형을 이루기 힘들며 반대로 계면활성제농도가 너무 짙으 면 니켈립자의 성장속도가 떠지고 생성속도가 빨라지므로 립자가 적합한 크기까지 성장하 는데 많은 시간이 걸린다.

제조한 β -Ni(OH)₂의 XRD도형은 그림 4와 같다.

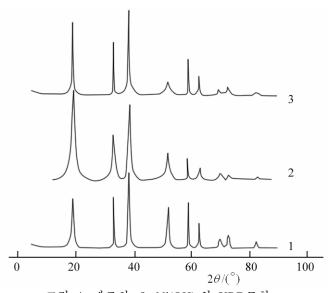


그림 4. 제조한 β -Ni(OH)₂의 XRD도형 1-계면활성제를 첨가하지 않은 시료, 2-계면활성제를 첨가한 시료, 3-표준시료

그림 4에서 보는바와 같이 제조한 *β*-Ni(OH)₂의 XRD도형은 표준시료(《JCPDS 14-117》) 와 일치한다.

다음으로 수산화니켈전극의 1C고속충방전특성을 고찰하였다.

1C로 고속충방전시켰을 때 발포니켈을 집전체로 리용한 니켈전극의 충방전특성곡선 은 그림 5와 같다

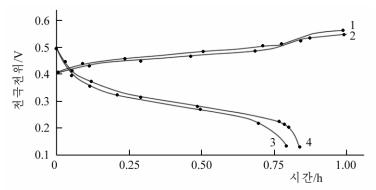


그림 5. 발포니켈을 집전체로 리용한 니켈전극에서의 고속충방전곡선(1C) 1-계면활성제를 첨가하지 않고 제조한 고밀도β-Ni(OH)₂로 만든 니켈전극의 충전곡선, 2-계면활성제를 첨가하여 제조한 고밀도β-Ni(OH)₂로 만든 니켈전극의 충전곡선, 3-계면활성제를 첨가하지 않고 제조한 고밀도β-Ni(OH)₂로 만든 니켈전극의 방전곡선, 4-계면활성제를 첨가하여 제조한 고밀도β-Ni(OH)₂로 만든 니켈전극의 방전곡선

그림 5의 자료로부터 계산한 계면활성제를 첨가하여 제조한 고밀도 β -Ni(OH) $_2$ 로 만든 니켈전극과 계면활성제를 첨가하지 않고 제조한 고밀도 β -Ni(OH) $_2$ 로 만든 니켈전극의 방전비용량은 각각 210, 180mAh/g으로서 계면활성제를 첨가하여 제조한 고밀도 β -Ni(OH) $_2$ 로 만든 니켈전극이 30mAh/g 더 크다. 즉 계면활성제를 첨가하여 제조한 고밀도 β -Ni(OH) $_2$ 로 만든 니켈전극이 종전의 공업용니켈전극보다 더 좋다는것을 알수 있다.

맺 는 말

비이온계면활성제인 트윈-80을 첨가하면 립자크기가 균일한 고밀도 β $-Ni(OH)_2$ 을 쉽게 제조할수 있으며 이때 적합한 트윈-80의 농도는 5mL/L이다.

참 고 문 헌

- [1] 김일성종합대학학보(자연과학), 56, 8, 120, 주체99(2010).
- [2] Yingjie Liu; Chemical Physics Letter, 699, 167, 2018.
- [3] 赵力; 化学通报, 8, 513, 2001.
- [4] 刘小虹; 电池工业, 9, 3, 2004.

주체109(2020)년 4월 5일 원고접수

Effect of Surfactant on the Preparation of Spherical Ni(OH)₂

Kim Tok Song, Pak Chang Hun

Adding the non-ionic surfactant, Tween-80, in the reaction solution, the homogeneous high density spherical β -Ni(OH)₂ can be prepared easily. The most suitable concentration of Tween-80 is 5mL/L.

Keywords: Ni(OH)₂, Tween – 80